PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-219943

(43)Date of publication of application: 08.08.2000

(51)Int.CI.

C22C 38/00 B22D 11/06 B22F 9/04

H01F 1/06

(21)Application number: 11-022902

(71)Applicant : SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

29.01.1999

(72)Inventor: HASHIMOTO TAKAHIRO

SATO KOJI

HIROTA KOICHI MINOWA TAKEHISA

(54) ALLOY THIN STRIP FOR RARE EARTH MAGNET, ALLOY FINE POWDER AND THEIR PRODUCTION

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the density of a sintered body at a low temp. by controlling its thickness to a specified range, allowing it to contain chill crystals of specified grain size in a specified volume ratio in the vicinity of the cooling face, furthermore controlling the volume ratio of the part in which a-Fe of specified grain size to the specified one and composing the balance of granular crystals of specified grain size and columnar

SOLUTION: By a roll rapid cooling method, an alloy thin strip for the raw material of a permanent magnet having 30 to 1000 μ m thickness, contg. chill crystals of \leq 3 μ m grain size by 1 to 30% volume ratio in the vicinity of the cooling face, and in which the volume ratio of the part in which a-Fe of $\leq 3~\mu m$ average grain size is precipitated is 1 to 10%, and the balance is composed of granular crystals of 3 to 50 μ m grain size and columnar crystals of 3 to 100 μ m minor axis and 20 to 600 μ m major axis can be obtd. By pulverizing this thin strip, fine powder having a grain size distribution in which the ones of $\leq 3~\mu m$ average grain size are contained by 1 to 30 vol.%, and the grain size of the balance is 3 to 10 μ m and large in an R rich phase and a B rich phase of the low m.p. can easily be obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3693839

[Date of registration]

01.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

AVAILABLE COP

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-219943 (P2000-219943A)

(43)公開日 平成12年8月8日(2000.8.8)

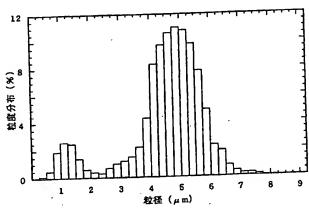
•		(43) 22 84 1
(51) Int.Cl.' C 2 2 C 38/00 B 2 2 D 11/06 B 2 2 F 9/04 H 0 1 F 1/06	酸別記号 303 360	FI C22C 38/00 303D 4E004 B22D 11/06 360B 4K017 B22F 9/04 C 5E040 E H01F 1/06 A 審査開求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)
(21)出願番号 (22)出願日	特願平11-22902 平成11年1月29日(1999.1.29)	(71)出顧人 000002060 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 橋本 貴弘 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化 学工業株式会社磁性材料研究所内 (72)発明者 佐藤 孝治 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化 学工業株式会社磁性材料研究所内 (74)代理人 100062823 弁理士 山本 亮一 (外2名)
		最終頁に続く

希土類磁石用合金薄帯、合金微粉末及びそれらの製造方法 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 低い温度で焼結体を高密度化することを可能 とする希土類永久磁石を製造するのに適した原料と、そ の原料の調製方法を提供する。

【解決手段】 R-T-B系希土類永久磁石原料用の合 金容湯をロール急冷法で急冷して、薄帯の厚さが30~ 1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~30% の粒径 3 μ m以下のチル晶を有し、残部は、粒径 3 ~ 5 Ομ mの粒状結晶、及び短軸が 3~100μm、長軸が 20~600μ mの柱状結晶、平均粒径3μ以下のαー Feの析出している部分からなるものとする。また、前 記永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕し、その粗粉砕粉末 を更に微粉砕して得られる微粉末であって、粒径 3 μ m 以下の微粉末が1~30%含まれ、残部の粒径が実質的 に3~10μmであるものとする。粗粉砕する方法が、 永久磁石原料用合金薄帯に水素を吸蔵させた後脱水素化 を行う方法であり、かつ、微粉砕がジェットミルにより 行われることであることが好ましい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 合金溶湯をロール急冷法で急冷して得ら れる実質的にR2 T14B(Rは希土類元素、Tは遷 移金属を表す) からなる薄帯であって、薄帯の厚さが3 0~1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~3 0%の粒径 3μm以下のチル晶を有し、かつ、平均粒径 3μm以下のαーFeの析出している部分が体積率で1 ~10%あり、残部は、粒径3~50μ mの粒状結晶、 及び短軸が3~100μm、長軸が20~600μmの 柱状結晶からなることを特徴とする永久磁石原料用合金

【請求項2】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、その粗粉砕粉末を更に微粉砕して得られる 微粉末であって、粒径 3 μ m以下の微粉末が 1 ~ 3 0 v o 1 %含まれ、残部の粒径が実質的に 3 ~ 1 0 μ mであ ることを特徴とする永久磁石原料用合金微粉末。

【請求項3】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合し、その 混合粗粉砕粉末を更に微粉砕して得られる微粉末であっ て、粒径3μm以下の微粉末が1~30vol%含ま れ、残部の粒径が実質的に3~10μmであることを特 徴とする永久磁石原料用合金微粉末。

【請求項4】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合しまたは 混合しないで、粗粉砕粉末を更に微粉砕することを特徴 とする、請求項2または請求項3記載の永久磁石原料用 合金微粉末を製造する方法。

【請求項5】 請求項4記載の発明において、永久磁石 原料用合金薄帯を粗粉砕する方法が、永久磁石原料用合 金薄帯に水素を吸蔵させた後脱水素化を行う方法であ り、かつ、微粉砕がジェットミルにより行われることを 特徴とする、永久磁石原料用合金微粉末を製造する方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気特性に優れた 希土類永久磁石を製造するのに適した原料とその原料の 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】希土類永久磁石は、優れた磁気特性と経 済性のため電気・電子機器の分野で多用されており、近 年益々その高性能化が要求されている。これら希土類永 久磁石の内R-T-B系希土類永久磁石(RはN dを主 体とした希土類元素、TはFe、又はFe及びCoであ る遷移金属)は、希土類コバルト磁石に比べたとき、主 要元素であるNdがSmより豊富に存在すること、高価 なCoを多用しないこと、から原材料費が安価であり、 磁気特性も希土類コバルト磁石を遙かに凌ぐ、極めて優 れた永久磁石である。従来、R-T-B系希土類永久磁 石原料用合金は、合金溶湯を金型に鋳造する金型鋳造法

により製造されてきた。この合金の冷却凝固過程におい て初晶γーFeが析出し、それが冷却後αーFeとして 偏析する。 α – F e は永久磁石製造工程の中の微粉砕工 程において、その粉砕能力を悪化させ、焼結工程後の磁 石に残存すれば磁気特性の低下をもたらす。そのため、 髙温で長時間にわたる均質化熱処理を施してαーFeを 消失させることが必要となるが、この均質化熱処理によ り合金中の主相 (R 2 T 1 4 B) の結晶粒径が粗大化 し、磁気特性を低下させると共に、製造コストも上昇さ せてしまう。そこで、ストリップキャスティング法等の 10 急冷技術を用いて、α-Feの偏析を抑制すると共に、 主相の結晶粒径を細かくした永久磁石原料用合金を製造 し、それを用いて永久磁石を製造することが報告されて

【0003】特許第2665590号では、主相(R2 Τι4 Β) 結晶が短軸 3~20μ mの均質な柱状結晶 であり、この永久磁石原料用合金を用いると保磁力(i Hc) の高い磁石を製造できるとしている。特許第26 39609号では、冷却速度10~500℃/秒で均一 に凝固させ、主相の結晶粒径が短軸 0. 1~50μm、 長軸 0. 1~100 μ m である永久磁石原料用合金を製 造し、これを用いることにより磁石の残留磁束密度(B r) を上昇させている。特開平7-176414号で は、平均粒径3~50μmの柱状結晶の主相用母合金と 平均粒径 0. 1~20μ mの粒界用助剤とを混合し、水 素を吸蔵させる方法で磁気特性を上げ、更に粉砕性も上 げている。特開平9-170055号では、鋳造後の8 00~600℃の冷却を10℃/秒以下に制御すること で、主相の平均粒径が20~100μmで、N d リッチ 相間隔が 1 5 μ m以下の合金をつくり、残留磁化を上昇 させている。これらどの報告においても、平均粒径の揃 った均質な原料用合金を用いて、粒度分布が均一な微粉 を得ることで、磁気特性を向上させているのが特徴であ

【0004】希土類永久磁石は、金型鋳造法、又は急冷 法によって製造された原料用合金を粉砕して得られた微 粉末を磁場中で加圧成型した後、真空中で焼結するとい う粉末冶金工程で製造される。希土類永久磁石における 焼結工程は、液相焼結と言われるもので、微粉末の成型 体を約1100℃ (組成によって違う) に加熱すること で液相量が増え、収縮して密度が上がり、残留磁東密度 が上がることを利用している。焼結終了後に冷却する と、液相にならなかった主相の周りを融点の低い相であ るR(N d)リッチ相が囲み、平均粒径3~10μ mの 主相が分散することで保磁力が発生する。残留磁束密度 を上げるには焼結密度を上げる必要があり、主相が完全 に液相になってしまう温度を上限として、焼結温度を高 くした方が良い。

【0005】一方、保磁力は、焼結温度を高くすればい いというものではなく、一般的には残留磁束密度が最大 3

となる温度よりも約100℃低い温度で最大となってい た。別の言い方をすると、保磁力は、焼結体密度が真密 度の約90%に上がったところで最も高くなり、それ以 上に加熱すると、主相が粒成長を起こして粒径が大きく なり、主相の分散性が低下するので、保磁力は低下して しまう。特に、真密度の99.5%を超える焼結体密度 になるまで加熱すると、主相が急激に粒成長して保磁力 が急激に低下すると共に、角型性も低下してしまう。そ こで、一般的には、残留磁束密度と保磁力とのバランス を考えて、焼結体密度が真密度の98~99.5%にな るような温度が最適焼結温度とされている。以上のこと から、これまでの最適焼結温度と比較して低い温度で焼 結体密度を上げることが可能となれば、焼結体中の主相 の粒径を大きくさせないから、残留磁束密度の値を損な うことなしに保磁力を大きくすることが可能となる、と 考えられる。

【0006】保磁力を大きくすることを目的として最適 焼結温度を下げるには、液相になり易い、融点の低い相 であるRリッチ相を増やす組成にする方法と、微粉末の 粒径を細かくする方法とがある。前者の場合、確かに焼 結温度が下がり保磁力が上昇するが、相対的に主相の割 合が低下してしまい、残留磁束密度が低下してしまうの で好ましくない。後者の場合、微粉末の表面積が増える ことにより、酸素濃度が増えてしまう。酸素はRと反応 してR2 O3 となり、Rリッチ相の最が減ってしまう ので好ましくない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上に述べた 点を踏まえて、低い温度で焼結体を高密度化することを 可能とする希土類永久磁石を製造するのに適した原料 と、その原料の製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、その目的を達 成するために、合金容湯をロール急冷法で急冷して得ら れる実質的にR2 T14B(Rは希土類元素、Tは遷 移金属を表す) からなる薄帯であって、薄帯の厚さが3 0~1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~3 0%の粒径 3μm以下のチル晶を有し、かつ、平均粒径 $3~\mu$ m以下の α - F e の析出している部分が体積率で 1~10%あり、残部は、粒径3~50μmの粒状結晶、 及び短軸が3~100μm、長軸が20~600μmの 柱状結晶からなるものとする。また、前記永久磁石原料 用合金薄帯を粗粉砕し、その粗粉砕粉末を更に微粉砕し て得られる微粉末であって、粒径3μm以下の微粉末が 1~30 v o l %含まれ、残部の粒径が実質的に3~1 0 μ m であるものとする。更に、永久磁石原料用合金薄 帯を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合し、そ の混合粗粉砕粉末を更に微粉砕して得られる微粉末であ って、粒径3μ m以下の微粉末が1~30vol%含ま れ、残部が粒径が実質的に3~10μmであるものとす

る。また、永久磁石原料用合金微粉末を製造するために、永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合しまたは混合しないで、粗粉砕粉末を更に微粉砕する。永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕する方法が、永久磁石原料用合金薄帯に水素を吸蔵させた後脱水素化を行う方法であり、かつ、微粉砕がジェットミルにより行われることであることが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明は、チル晶と粒状結晶部分と柱状結晶部分とαー Feの析出部分とが混在する結晶組織の永久磁石原料用 合金薄帯を用いることで、低い温度で焼結体を高密度化 することを可能とし、焼結体中の主相が粒成長すること なく粒径を細かく保ち、高残留磁束密度で高保磁力のR -T-B系希土類永久磁石を得ることができるとの知見 を基本としている。本発明者等は、ロール急冷法によれ は、冷却面近傍に体積率で1~30%の粒径3μm以下 のチル晶を有し、かつ、平均粒径 3 μ m以下のαーF e の析出している部分が体積率で1~10%あり、残部は 粒径3~50μmの粒状結晶、及び短軸3~100μ m、長軸20~600μmの柱状結晶からなる永久磁石 原料用合金薄帯を得ることができること、また、その永 久磁石原料用合金薄帯を用いることで、平均粒径 3 μ m 以下のものが1~30%含まれ、残部の粒径が3~10 μmである粒度分布を持ち、かつ、低融点なRリッチ相 とBリッチ相の多い微粉末を容易に得ることができ、そ の微粉末を用いることで、従来の均一な粒度分布を持つ。 微粉末を用いた時よりも20~100℃低温で焼結でき るようになり、保磁力が大きくなることを見出した。

【0010】微粉末の平均粒径を細かくする方法で最適焼結温度を下げて保磁力を上昇させようとした場合、既に述べたように、酸素濃度が上昇するために、磁石を高特性化するのには限界があった。しかし、平均粒径を変えずに、細かい粒径のものが含まれる微粉末を用いると、磁石を高特性化することができる。 具体的には、粒径3 μ m以下のものが1 \sim 30%含まれ、残部の粒径が3 \sim 10 μ mである粒度分布を持った微粉末を用いると、粒径3 μ m以下の微粉末が存在するために最適焼結温度は20 \sim 100 $^{\circ}$ C低くなり、保磁力が上昇する。この場合、平均粒径がほぼ同じなので、酸素濃度の上昇はほとんどない。

【0011】粒径 3μ m以下のものが $1\sim30$ %含まれ、残部の粒径が $3\sim10\mu$ mである粒度分布を持った 微粉末を製造するには、均一な結晶組織の原料用合金を 使っていたのでは難しい。理由は以下の通りである。

- (1) 均一な結晶組織の原料用合金を使うと、粉砕され た微粉末は均一な粒度分布となり易い。
- (2) 微粉砕条件の変更により同じ平均粒径で粒径 $3\,\mu$ m以下の微粉末を増やそうとすれば、粒径 $1\,0\,\mu$ m以上の大きなものも混入してしまう。

50

30

(3) 粒径 3 μ m以下の微粉末と平均粒径 3~10 μ m の微粉末とを別々に粉砕して混合する方法では、完全には混ざらない。また、微粉末は非常に酸化し易く、酸素濃度が上昇してしまうので、Vブレンダー等を用いて混合する工程を追加することは、好ましいものとは言えない。

【0012】したがって、平均粒径3μm以下のものが 1~30%含まれ、残部の粒径が3~10μmである粒 度分布を持つ微粉末を製造するには、チル晶を含む複数 の相が混在した結晶組織の原料用合金を使えば良いこと になる。チル晶を含む複数の相が混在した結晶組織を有 する永久磁石原料用合金は、合金溶湯をロール急冷法で 急冷して得られる薄帯によって実現される。原料用合金 薄帯は、単ロール法、又は双ロール法により溶湯を急激 に冷却して製造される。合金溶湯をロールに接触させて 冷却疑固させると合金薄帯ができるが、合金薄帯中の冷 却速度は一定ではない。例えば単ロール法の場合、合金 薄帯はロール接触面から非接触面へと順に冷却される が、合金薄帯が冷却されると同時にその熱量がロールへ と移動してロールの温度が上昇する。よって、合金薄帯 がロールと接触している間は合金薄帯とロールの温度差 が順次小さくなり、冷却速度が遅くなっていく。つま り、合金薄帯のロール接触面は冷却速度が速いが、非接 触面は冷却速度が遅い。

【0013】合金薄帯がロールから剥がれた後1回転す る間にロールは冷却され、再び合金溶湯がロールに接触 して合金薄帯が製造される。ロールの材質、厚さ、直 径、回転数、冷却水温度、冷却水流量等を変えることで 冷却速度を変えることができ、それにより、複数の相が 混在した結晶組織を有する原料用合金を製造することが できる。具体的には、ロール接触面近傍では約1000 0℃/秒以上の冷却速度で、粒径3 μ m以下のチル晶を つくる。次の層では約1000℃/秒~約10000℃ /秒の冷却速度で、粒径3~50μmの粒状結晶をつく る。次の層では約200℃/秒~約1000℃/秒の冷 却速度で、短軸3~100μm、長軸20~600μm の柱状結晶をつくる。次に約200℃/秒以下の冷却速 度でαーFeが析出する。ここで、長軸が短軸の2倍未 満のものを粒状結晶、2倍以上のものを柱状結晶とす る。合金薄帯中の結晶相の量的割合は、冷却面近傍に体 積率で1~30%の粒径3μm以下のチル晶を有し、か つ、平均粒径3μm以下のα-Feの析出している部分 が体積率で1~10%あり、残部は、粒径3~50μm の粒状結晶、及び短軸が3~100μm、長軸が20~ 600μmの柱状結晶からなるようにする。また、チル 晶、粒状結晶、柱状結晶以外のものが存在しても、体積 率で1%以下であれば問題ない。チル晶の割合が体積率 で1%未満では、粒径3 μ m以下の微粉末の割合が少な くなって、本発明の効果が得られない。また、30%を 超えると粒径 3 μ m以下の微粉末の割合が増えて、酸素 濃度が上昇してしまうので好ましくない。

【0014】αーFeの偏析と同時に偏析するRリッチ 相とBリッチ相は低融点な相であり、最適焼結温度を下 げる効果があることがわかった。つまり、Rリッチ相と Bリッチ相は酸化し易い相であるので、酸素濃度を増加 させるというマイナスの効果もあるが、最適焼結温度を 下げるというプラスの効果もあり、αーFeの偏析して いる部分が体積率で1~10%ではプラスの効果の方が 大きいことが分かった。また、α-Γεの平均粒径が微 10 粉砕粒径より細かい 3μ m以下であれば、 α - Fe自身 が粉砕される必要がないので、微粉砕能力を悪化させる こともない。そして、この場合は一つの微粉末中にαー Feと主相が共存することになり、焼結工程時にその共 存する主相の結晶方向に従うために、配向度が落ちて残 留磁化が落ちることもない。以上の理由で、平均粒径3 μm以下のα-Feの偏析している部分が体積率で1~ 10%あることが望ましい。

【0015】得られた合金薄帯を粗粉砕する。粗粉砕は、ブラウンミル等、通常の粉砕手段が採用され得る。しかし、粗粉砕工程において、合金薄帯をブラウンミル等で粗粉砕するのではなく、水素を吸蔵させた後に脱水素化を行うという水素化粗粉砕を行うことがより好ましい。これは、水素吸蔵により格子間隔が膨張してクラックが発生し、粗粉末となるのであるが、これが好ましい理由は、微粉砕のときに粗粉末が結晶組織の粒界で割れ易くなるからである。また、脱水素化工程では真空中で400~700℃に加熱するが、加熱することで主相から水素が十分に放出される。一合金法の場合には、得られた粗粉末をジェットミル等により微粉砕する。また、二合金法の場合には、別にブラウンミル等で粗粉砕した粒界用助剤粗粉末と混合し、混合粗粉末をジェットミル等により微粉砕を行う。

【0016】ジェットミルでの微粉砕において、粒径3 μm以下のチル晶は粒径3μm以下の微粉末に粉砕さ れ、他の部分は粒径3~10μmの微粉末になるまで粉 砕される。微粉末の粒径別の割合は、粒径 3 μ m以下の 微粉末が1~30vol%含まれ、残部の粒径が実質的 に3~10μmであるようにする。粒径3μm以下の微 粉末が1vo1%以下では、液相焼結の温度が高温にな り、30vol%を超えると、酸素濃度が上昇してしま って、必要な磁気特性が得られない。得られた微粉末 は、配向させるために磁場中で加圧成型する。その後、 成型体は真空中で、従来の方法で調製された微粉末を使 用したときと比べて20~100℃低い温度で、焼結す る。本発明について、薄帯内に複数の結晶組織がある場 合のその割合と、それによる効果について説明してきた が、要するに、厚さ等を含めて薄帯内にばらつきがあっ ても、全体として体積率で1~30%の粒径3μm以下 のチル晶を有し、かつ、平均粒径 3μ m以下の α - F eの析出している部分が体積率で1~10%あり、残部は

30

40

7

粒径 $3\sim50\mu$ mの粒状結晶、及び短軸 $3\sim100\mu$ m、長軸 $20\sim600\mu$ mの柱状結晶からなっていればよい。これは薄帯の製造条件が広いという意味を持っており、製造を安定して続けていく上で、本発明の合金薄帯を使うことは非常に好ましい。

[0017]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げて説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

[実施例1]組成式12.5Nd-6.0B-1.5C o-80.0Fe (各原子%) の組成の金属溶湯を、A r雰囲気中で単ロール法にて冷却して、合金薄帯を製造 した。この合金薄帯全体の平均として、厚さが約280 μmであり、冷却面近傍に体積率で11%のチル晶、そ れから35%の粒径5~30μmの粒状結晶、それから 48%の短軸5~40μm、長軸50~260μmの柱 状結晶、更に非冷却面側に体積率で6%の平均粒径1. 8μmのα-Feが偏析している部分からなっていた。 この合金薄帯の断面の代表的な偏光顕微鏡による組織写 真を図1に示す。断面写真の下部がロール接触面であ り、ここにチル晶ができている。そして、図1の左上の 四角で囲んだ、偏光顕微鏡では結晶の大きさがよく分か らない部分を、拡大した反射電子組成像が図2で、黒く 写っている部分がα-Feである。製造した合金薄帯 を、ブラウンミルによって平均粒径200μmに粗粉砕 して主相用母合金とし、これを90重量%、別途ブラウ ンミルによって平均粒径200μmに粗粉砕した20. $0 \, \text{Nd} - 1 \, 0. \, 0 \, \text{Dy} - 6. \, 0 \, \text{B} - 4 \, 4. \, 0 \, \text{Co} - 2$ 0.0Fe(各原子%)の組成の粒界用助剤を10重量 %、の割合で混合し、その後ジェットミルにより微粉砕 を行った。

【0018】得られた微粉末は、平均粒径 4.5μ mであり、その内粒径 3μ m以下のものが 8%あり、その平均粒径は 1.9μ mであった。この微粉末の粒度分布を図 3に示す。 3μ m以下にもう一つのピークが見られる。得られた微粉末を 15kOeの磁場中で配向させながら、1ton/cm²の圧力で加圧成型した。この成型体を真空中で 1040℃で 2時間焼結し、その後 Ar 雰囲気中で 1時間時効熱処理を行い、磁石合金を作製した。

【0019】 [実施例2] 実施例1と同じ合金薄帯を用いて、水素化粗粉砕で粗粉砕した。水素化粗粉砕は、常温で2時間水素吸蔵処理を行い、その後真空中で600℃で2時間加熱して脱水素化処理を行った。その後は実施例1と同様にして微粉末を得た。得られた微粉末の平均粒径は4.5μmであり、その内粒径3μm以下のものが12%あり、その平均粒径は1.5μmであった。この微粉末の粒度分布を図4に示す。3μm以下で見られるもう一つのピークがより高くなった。この微粉末を用いて、焼結温度を、実施例1より10℃低い、1030℃にしたこと以外は実施例1と同じ方法で磁石合金を

作製した。この1030℃は、この例で用いた微粉末に おける最適焼結温度である。

【0020】 [比較例1] 実施例1と同じ組成で、単ロール法によって、平均厚さが約270μmであり、冷却面近傍に体積率で4%の粒径5~35μmの粒状結晶、残部が短軸5~35μm、長軸50~270μmの柱状結晶からなる原料用合金薄帯を製造した。その後、焼結温度を実施例2より50℃高い、この合金の最適焼結温度である1080℃にした以外は、実施例2と同じ方法で磁石合金を作製した。途中得られた微粉末の平均粒径は4.6μmであり、その内粒径3μm以下のものが2%あり、その平均粒径は2.6μmであった。この微粉末の粒度分布を図5に示す。3μm以下にピークは見られない

【0021】 [比較例2] 焼結温度を実施例2と同じ1 030℃にした以外は比較例1と同じ合金薄帯を用い て、同じ方法で磁石合金を作製した。

[比較例3] 実施例1と同じ組成で、単ロール法によって主相用合金薄帯を製造した。得られた合金薄帯は、平均厚さが約300 μ mであり、冷却面近傍に体積率で10%のチル晶を、それから15%の粒径5~40 μ mの粒状結晶、それから52%の短軸5~40 μ m、長軸60~280 μ mの柱状結晶、非冷却面側に体積率で23%の平均粒径2.1 μ mの α - Feが偏析している部分からなる合金薄帯であった。その後、焼結温度を、実施例2より20 α -高い、この合金薄帯を用いたときの最適焼結温度である1050 α -にした以外は、実施例2と同じ方法で磁石合金を作製した。途中得られた微粉末の平均粒径は4.5 μ mであり、その内粒径3 μ m以下のものが13%あり、その平均粒径は1.5 μ mであった。

【0022】 [比較例4] 実施例1と同じ組成で単ロール法により主相用合金薄帯を製造した。得られた合金薄帯は、平均厚さが約 1000μ mであり、冷却面近傍に体積率で6%の粒径 $5\sim40\mu$ mの粒状結晶、それから64%の短軸 $5\sim45\mu$ m、長軸 $200\sim700\mu$ mの柱状結晶、非冷却面側に体積率で30%の平均粒径 8.2μ mの α -Feが偏析している部分からなる合金薄帯であった。その後、焼結温度を、実施例2より70℃高い、この合金薄帯を用いたときの最適焼結温度である100℃にした以外は、実施例2と同じ方法で磁石合金を作製した。途中得られた微粉末の平均粒径 5.5μ mであり、その内粒径 3μ m以下のものが1%あり、その平均粒径は2.8%である。

【0023】表1に、二合金法で磁石を作製した実施例 1~2と比較例1~4について、合金薄帯の厚さ、結晶 組織とその割合、水素化粗粉砕の有無、微粉末の平均粒径と3μm以下の割合、得られた磁石合金の焼結温度、主相の平均粒径、磁気特性(残留磁束密度Br、保磁力 i Hc、最大エネルギー積(BH)max)、及び焼結体密度ρを示す。

-5-

[0024]

表 1 】 + 約果用助剤 (20, ONd-10, ODv-6, OB-44, OCo-20, OFe)

			合 金	: 薄 存	特		1		微 粉	末
	厚さ (μm)	チル晶 (%)	粒状結晶 (%)	柱状結晶 (%)	α-Fe (%)	α - F e の 粒径 (μm)	本務 华	均粒径(μm)	3 μ m 以下の 割合 (%)	3 μ m以下の平 均粒径 (μ m)
実施例1	280	11	35	48	6	1.8	無	4.5	8	1.9
実施例2	280	11	35	48	6	1.8	有	4.5	12	1.5
比較例1	270	0	4	96	0	-	有	4.6	2	2. 6
比較例2	270	0	4	96	0	-	有	4.6	2	2.6
比較例3	300	10	15	52	23	2.1	. 有	4.5	13	1.5
比較例4	1000	0	6	64	30 ·	8. 2	有	5.5	1	2.8

		焼 結 体 (磁 石 合 金)							
	焼結温度 (℃)	平均粒径 (μm)	Br (kG)	iHc (k0e)	(BH) max (MGOe)	ρ (g/∞)	酸素濃度(重量%)		
実施例1	1040	5.4	13.6	15.8	44.5	7.56	0.49		
実施例2	1030	5.1	13.6	15.7	44.6	7. 55	0.50		
比較例1	1080	6.9	13.6	13.7	44.6	7. 54	0.46		
比較例2	1030	5.0	12.2	16.6	36. 0	7. 10	0.46		
比較例3	1050	6.1	13.5	14.0	43.8	7.54	0.62		
比較例4	1100	7.5	13.5	11.2	43.9	7. 56	0.72		

【0025】チル晶も平均粒径 3μ m以下の α -Feも存在しない合金薄帯を用いた比較例 1は、焼結体密度を十分に上昇させるためには、1080Cで焼結する必要があった。それに対して、チル晶が存在している実施例 1及び 2では、それぞれ1040C、1030Cで焼結体密度が十分に上昇しているため、比較例 1と比べて焼結体の主相が粒成長せず、平均粒径が小さく保たれるために、iHcが高くなっている。また、実施例 1よりも、水素化粗粉砕をした実施例 2の方が、 3μ m以下の微粉末の割合が多くなり、最適焼結温度が更に低くなり、得られた磁石合金の特性においてもより望ましい結果が得られた。比較例 1と同じ合金薄帯を用いて同じ方法で、焼結温度だけ実施例 2と同じにしたのが比較例 2であるが、焼結体密度が低く、Br及び(BH) 2 max が低い結果となっている。

【0026】比較例3は、チル晶を有し、かつ、平均粒径 2.1μ mの α -Feが偏析している部分が体積率で23%ある合金薄帯の場合である。この場合、微粉末中の粒径 3μ m以下の粒子の量が多くなり、その平均粒径は小さくなるため、焼結体中の酸素濃度が高くなり、N

d2 O3 の量が増えてしまい、Rリッチ相の量が減
の、iHcが低くなってしまう。比較例4は、平均粒径
8.2μmのα-Feが偏析している部分が体積率で3
0%ある合金薄帯の場合である。この場合、酸素濃度が高くなってしまうだけでなく、平均粒径8.2μmのα-Feの存在のために微粉砕性が悪くなり、微粉末の平均粒径が大きくなってしまうため、iHcが低くなってしまう。以上のことから、チル晶を有し、平均粒径3μm以下のα-Feの析出している部分が体積率で1~1
0%ある合金薄帯を用いて磁石合金を製造することは、磁気特性の向上に有効であることが分かる。

0 【0027】次に、組成式13.2Nd-0.8Dy-6.0B-4.5Co-75.5Fe(各原子%)の組成で、一合金法により磁石合金を製造したものが実施例3~4と比較例5~8についての、表1と同様の項目の測定結果を、表2に示す。一合金法での製造方法は、粒界用助剤を混合しない以外は二合金法と同じである。

[0028]

【表2】

			(10 EN	4_6 AB_1 S	Co-80, OFe)						
	<u></u>	法=合金科) (12. 3/0	0-6. 00-1. 3	Co-80. 0Fe)			省郡 华		微粉	末
		合金神智 西ネ チル晶 粒状結晶 柱状結晶 α-Fe α-Feの							均粒径(μm)	3 μm以下の 割合 (%)	3 μ m 以下の平 均粒径 (μ m)
		(µm)	(%)	(%)	(%)	(%)	1.6	魚	4.6	1	2
١	奥施例3	290	10	47	38	5	1.6	有	4.6	11	1.6
١	実施例4	290	10	47	94	-		有	4.6	2	2.7
	比較例 5	300	0	6-	94	1 0		有	4.6	2	2.1
	比較例6	300	<u> </u>	6	49	25	2.0	有	4.7	10	1.7
	比較例7	300	1 7	19	66	29	7.5	有	5.4	1	2.8
1	H- 数例8	1000	1 0	5	66						

			焼箱	* (磁石	合 金)		
	焼結温度	平均粒径 (μm)	Br (kG)	iHc (k0e)	(BH) max (MGOe)	ρ (g/œ)	酸素濃度 (重量%)
	(%)	5,4	13.4	15.6	43.5	7.57	0.54
実施例3	1030	5.0	13.4	17.0	43.5	7. 56	0. 52
夹施例4	1020	 	13.4	14.6	43.4	7.55	0.50
比較例5	1070	6.6	12.0	16.8	34.9	7.05	0. 50
比較例6	1020	5.1		14.1	42.9	7. 55	0.63
比較例7	1040	5.9	13. 3		42.3	7.54	0.71
比較例8	1090	7.1	13. 2	11.8	42.3		

【0029】体積率で8%のチル晶を有し、平均粒径3 μ m以下の α — F e の析出している部分が体積率で4% ある合金薄帯を用いた実施例3 及び4 の磁気特性が高くなっており、一合金法の場合においても、チル晶を有し、平均粒径 3μ m以下の α — F e の析出している部分が体積率で $1\sim10\%$ ある合金薄帯を用いて磁石合金を製造することは、磁気特性の向上に有効であることを示している。

[0030]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の微粉末を用いて磁石合金を製造すれば、残留磁束密度Br、最大エネルギー積(BH)max を損なうことなく、焼結温度を低めて保磁力 i Hcを高めることができる。また、本発明の合金薄帯を用いることにより、平均粒径を変えることなしに粒径3μm以下の微粉末の割合を高めることができる。また、冷却面(ロール接触面)と非冷却面

(ロール非接触面) との間の全てにわたり均一な結晶粒 径を有する合金薄帯よりも、複数の相を持つ合金薄帯の 方が製造条件が広いので、製造を安定して続けていくこ とが容易となり、本発明の合金薄帯を使うことは非常に 好ましい。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1における合金薄帯の偏光顕微鏡による組織写真である。

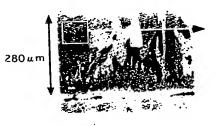
【図2】 図2の左上四角部分を拡大した組織写真である。

【図3】 実施例1における微粉末の粒度分布を示すグ ラフである。

30 【図4】 実施例2における微粉末の粒度分布を示すグラフである。

【図5】 比較例1における微粉末の粒度分布を示すグラフである。

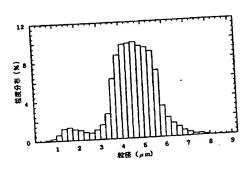
【図1】

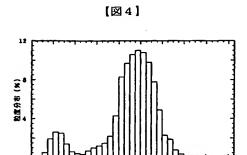


【図2】

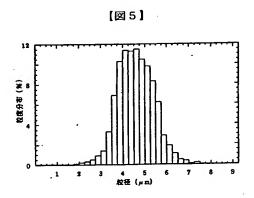


[図3]





4 5 数键 (pm)



フロントページの続き

(72) 発明者 廣田 晃一

福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化

学工業株式会社磁性材料研究所内

(72) 発明者 美濃輪 武久

福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化

学工業株式会社磁性材料研究所内

Fターム(参考) 4E004 DB02 TA02 TA03 4K017 AA04 BA06 BB06 BB12 CA07 DA04 EA03 EA08 EC02 5E040 AA04 BD01 CA01 HB17 NN06 NN17

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.